

Nanostructural Effects on Uncompensated Spin Ensemble in Oxide Thin Films Fabricated by RF Magnetron Sputtering

アグストリスノ マルリス ヌラツ

<https://hdl.handle.net/2324/7329493>

出版情報 : Kyushu University, 2024, 博士 (学術), 課程博士
バージョン :
権利関係 :



氏 名	アグストリスノ マルリス ヌラツ			
論 文 名	Nanostructural Effects on Uncompensated Spin Ensemble in Oxide Thin Films Fabricated by RF Magnetron Sputtering (RF マグネトロンスパッタリングで作製した酸化物薄膜における非補償スピアンサンブルのナノ構造効果)			
論文調査委員	主 査	九州大学	教授	湯浅 裕美
	副 査	九州大学	教授	板垣 奈穂
	副 査	九州大学	教授	薮田 久人
	副 査	九州大学	教授	白谷 正治

論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨

希薄磁性半導体である ZnO:Co 膜ではナノスケールの構造不均一性が、フェリ磁性絶縁体である Tm₃Fe₅O₁₂ (TmIG) 膜ではナノスケールの格子ひずみが、それぞれ非補償スピアンサンブルのナノ構造効果を通して磁気特性等に及ぼす影響に焦点をあて調査し、ナノスケールの構造不均一性を形成・制御し磁気特性を制御する新しい方法を提案・実証した。これらの結果は、電気電子工学上価値のある業績であり、博士（学術）の学位に値すると認める。